

488696-2026 - Διαγωνισμός

Ιρλανδία – Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots
OJ S 134/2026 15/07/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς - Γνωστοποίηση αλλαγών
Αγαθά

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Education Procurement Service (EPS)

Email: info@educationprocurementservice.ie

Νομική μορφή αγοραστή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Περιγραφή: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Αναγνωριστικό διαδικασίας: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 38000000 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): South-East (IE052)

Χώρα: Ιρλανδία

2.1.3. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

2.1.5. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Μέγιστος αριθμός παρτίδων για τις οποίες ένας προσφέρων μπορεί να υποβάλει προσφορές:
4

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Έγγραφο σύμβασης

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Περιγραφή: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 1

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 38000000 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): South-East (IE052)

Χώρα: Ιρλανδία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 48 Μήνες

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις

Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Καμία στρατηγική δημόσια σύμβαση

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: αγγλικά

Γλώσσες στις οποίες είναι ανεπισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης (ή μέρη αυτών): αγγλικά

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: αγγλικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία προσφορές: Επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 180 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Τόπος: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης:
Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί
Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: The High Court of Ireland

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης:
Education Procurement Service (EPS)

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: The High Court of Ireland

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Education Procurement Service (EPS)

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Παρτίδα: LOT-0002

Τίτλος: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Περιγραφή: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 2

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cρν): 38000000 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): South-East (IE052)

Χώρα: Ιρλανδία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 48 Μήνες

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις

Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Καμία στρατηγική δημόσια σύμβαση

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: αγγλικά

Γλώσσες στις οποίες είναι ανεπισημως διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης (ή μέρη αυτών): αγγλικά

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: αγγλικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία προσφορές: Επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 180 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Τόπος: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης:

Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: The High Court of Ireland

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Education Procurement Service (EPS)

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: The High Court of Ireland

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Education Procurement Service (EPS)

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Παρτίδα: LOT-0003

Τίτλος: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Περιγραφή: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 3

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 38000000 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): South-East (IE052)

Χώρα: Ιρλανδία

- 5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια**
Διάρκεια: 48 Μήνες
- 5.1.5. Αξία**
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 300 000,00 EUR
- 5.1.6. Γενικές πληροφορίες**
Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:
Δεν παραχωρείται συμμετοχή.
Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ
Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι
- 5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις**
Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Καμία στρατηγική δημόσια σύμβαση
- 5.1.9. Κριτήρια επιλογής**
Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης
- 5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων**
Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: αγγλικά
Γλώσσες στις οποίες είναι ανεπισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης (ή μέρη αυτών): αγγλικά
Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>
- 5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων**
Όροι υποβολής:
Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική
Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: αγγλικά
Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται
Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία προσφορές: Επιτρέπεται
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης
Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 180 Ημέρες
Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:
Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης
Τόπος: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>
Όροι της σύμβασης:
Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης:
Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί
Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι
- 5.1.15. Τεχνικές**
Συμφωνία-πλαίσιο:

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: The High Court of Ireland

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Education Procurement Service (EPS)

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: The High Court of Ireland

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Education Procurement Service (EPS)

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Παρτίδα: LOT-0004

Τίτλος: Plasma Deposition ,PECVD

Περιγραφή: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 4

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 38000000 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): South-East (IE052)

Χώρα: Ιρλανδία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 48 Μήνες

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις

Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Καμία στρατηγική δημόσια σύμβαση

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: αγγλικά

Γλώσσες στις οποίες είναι ανεπισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης (ή μέρη αυτών): αγγλικά

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: αγγλικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία προσφορές: Επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 180 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Τόπος: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης:

Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: The High Court of Ireland

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Education Procurement Service (EPS)

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: The High Court of Ireland

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Education Procurement Service (EPS)

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Education Procurement Service (EPS)

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Education Procurement Service (EPS)

Αριθμός καταχώρισης: IE 6609370 G

Ταχυδρομική διεύθυνση: Castletroy Limerick

Πόλη: Limerick

Ταχυδρομικός κώδικας: V94 DK53

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Mid-West (IE051)

Χώρα: Ιρλανδία

Email: info@educationprocurementservice.ie

Τηλέφωνο: 000

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Προφίλ αγοραστή: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών

8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: The High Court of Ireland

Αριθμός καταχώρισης: The High Court of Ireland

Τμήμα: The High Court of Ireland

Ταχυδρομική διεύθυνση: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Πόλη: Dublin

Ταχυδρομικός κώδικας: D07 WDX8

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Dublin (IE061)

Χώρα: Ιρλανδία

Email: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Τηλέφωνο: +353 1 8886000

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Οργανισμός προσφυγής

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

8.1. ORG-0003

Επίσημη ονομασία: European Dynamics S.A.

Αριθμός καταχώρισης: 002024901000

Τμήμα: European Dynamics S.A.

Πόλη: Athens

Ταχυδρομικός κώδικας: 15125

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Χώρα: Ελλάδα

Email: eproc-esender@eurodyn.com

Τηλέφωνο: +30 2108094500

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

TED eSender

10. Αλλαγή

Η έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης πρέπει να τροποποιηθεί

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Κύριος λόγος της αλλαγής

:

Ενημερωμένες πληροφορίες

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Είδος εντύπου: Διαγωνισμός

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς

Υποείδος προκήρυξης: 16

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: αγγλικά

Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 488696-2026

Αριθμός τεύχους EE S: 134/2026

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/07/2026